

Установка вакуумного напилення УРМ3.279.014 для нанесення тонкоплівкових композицій: хром/мідь

Технічні характеристики та можливості:

- граничний вакуум у робочому об'ємі – $5 \cdot 10^{-6}$ мм.рт.ст.
- іонне очищення – розряд у постійному полі; вакуум - $5 \cdot 10^{-2}$ мм.рт.ст.
- напилення:
 - **хрому** з дротяного вольфрамового випарника; вакуум - $5 \cdot 10^{-6}$ мм.рт.ст.; контроль напилення – візуальний та за зміною опору фоторезистора; товщина адгезійного підшару – до 80 нм.
 - **міді** з випарника - молибденового човника; вакуум - $5 \cdot 10^{-6}$ мм.рт.ст.; контроль напилення – візуальний та за зміною опору фоторезистора на початковій стадії напилення; товщина плівки – до 1000 нм.
- попереднє нагрівання підкладки та підтримання температури в процесі напилення – до 300°C .



Установка вакуумного напилення УРМ3.279.014



Підковпачне обладнання установки УРМ3.279.014



Позиція наплення Cr



Позиція наплення Cu